

Judul:

The Influence of silane gas flow rate on optoelectronic properties of
Uc-Si: H Prepared by HWC-VHF-PECVD Technique

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Technique

Nomor Panggil:

ITJOSCI

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)